

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【公開番号】特開2014-82130(P2014-82130A)

【公開日】平成26年5月8日(2014.5.8)

【年通号数】公開・登録公報2014-023

【出願番号】特願2012-230115(P2012-230115)

【国際特許分類】

H 01 J 35/14 (2006.01)

H 01 J 35/18 (2006.01)

H 01 J 35/08 (2006.01)

【F I】

H 01 J 35/14

H 01 J 35/18

H 01 J 35/08 C

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月4日(2014.11.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

また、ターゲット用薄膜255は、イオンビームスパッタのような薄膜堆積法で形成される。ホルダ部251の支持される側の端部も気密に接合されており、その内部にはキャップ258が設けられ、キャップ258の内部と外部との間で形成される流通路に水等の冷媒を循環できるよう構成されている。ダイヤモンド板256の厚さは、300μm~800μmであることが好ましい。